(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年10 月4 日 (04.10.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/111374 A1

(51) 国際特許分類:
A61M 16/06 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2007/057005

(22) 国際出願日: 2007 年3 月23 日 (23.03.2007)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2006-082899 2006 年3 月24 日 (24.03.2006) JP
特願2006-331959 2006 年12 月8 日 (08.12.2006) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 帝人ファーマ株式会社 (TEIJIN PHARMA LIMITED) [JP/JP]; 〒1000011 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 瀧下正英 (TAKISHITA, Masahide) [JP/JP]; 〒1910065 東京都日野市旭が丘四丁目３番２号帝人ファーマ株式会社 東京研究センター内 Tokyo (JP). 大村佳子 (OMURA, Keiko) [JP/JP]; 〒1910065 東京都日野市旭が丘四丁目３番２号帝人ファーマ株式会社 東京研究センター内 Tokyo (JP). 陳敦豪 (CHIN, Tongoh) [JP/JP]; 〒1910065 東京都日野市旭が丘四丁目３番２号帝人ファーマ株式会社 東京研究センター内 Tokyo (JP). 岡山貴光 (OKAYAMA, Takamitsu) [JP/JP]; 〒1910065 東京都日野市旭が丘四丁目３番２号帝人ファーマ株式会社 東京研究センター内 Tokyo (JP). 志村英治 (SHIMURA, Hideharu) [JP/JP]; 〒5670006 大阪府茨木市耳原三丁目４番１号帝人エンテック株式会社 大阪研究センター内 Osaka (JP). 藤本慎也 (FUJIMOTO, Shinya) [JP/JP]; 〒5670006 大阪府茨木市耳原三丁目４番１号帝人エンテック株式会社 大阪研究センター内 Osaka (JP). 彦坂徹 (HIKOSAKA, Toru) [JP/JP]; 〒5670006 大阪府茨木市耳原三丁目４番１号帝人エンテック株式会社 大阪研究センター内 Osaka (JP). 松永里絵 (MATSUNAGA, Satoe) [JP/JP]; 〒5670006 大阪府茨木市耳原三丁目４番１号帝人エンテック株式会社 大阪研究センター内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 三原秀子 (MIHARA, Hideko); 〒1000011 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号株式会社帝人知的財産センター内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

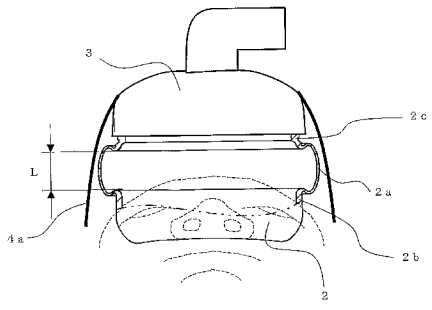
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) **Title:** NASAL MASK FOR VENTILATION

(54) 発明の名称: 呼吸用鼻マスク



(57) **Abstract:** A nasal mask (2) for ventilation, brought into contact with the face of the user and supplying positive pressure gas for ventilation to the nose of the user. The nasal mask (2) is made up of at least an intimate contact section (2b) coming into intimate contact with the face of the user and an elastic connection section (2a) for elastically connecting the intimate contact section (2b) and a frame installation section (2c) together. Even when positive pressure for ventilation is not applied, the face side and the frame installation section side of the elastic connection section (2a) are spaced apart from each other by a required distance. The nasal mask (2) for ventilation is advantageous that it can be installed on an appropriate position without application of positive pressure when the installation is started, does not obstruct the field of view of the user, and dries quickly after daily washing to avoid unsanitary conditions.

[続葉有]

WO 2007/111374 A1

(57) 要約:

本発明によれば、使用者の顔面と接触し、使用者の鼻への呼吸用陽圧ガスを供給するための呼吸用鼻マスク（２）であって、少なくとも、使用者の顔と密着する顔面密着部分（２ｂ）、フレームに取り付けられるフレーム取付部分（２ｃ）、および顔面密着部分（２ｂ）とフレーム取付部分（２ｃ）を弾性的に接続する弾性接続部分（２ａ）からなり、呼吸用陽圧を印加しない状態でも弾性接続部分（２ａ）の顔面側とフレーム取付部分側が必要な距離だけ離れていることを特徴とする呼吸用鼻マスク（２）が提供される。

かかる呼吸用鼻マスク（２）は、装着開始時に陽圧を印加することなく適正な位置に装着することができ、装着時に視界を妨げることが少なく、日常の水洗いによる洗浄後の乾燥時間遅延や不衛生な状況の発生を防止できる利点を有する。